(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 公 表 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公表番号

特表2005-534145 (P2005-534145A)

(43) 公表日 平成17年11月10日(2005.11.10)

(51) Int.C1. ⁷	F 1		テーマコード(参考)
HO5B 33/22	HO5B 33/22	Z	3K007
HO5B 33/12	HO5B 33/12	В	
HO5B 33/14	HO5B 33/14	Α	

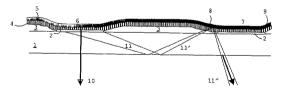
審查請求 未請求 予備審查請求 未請求 (全 14 頁)

(21) 出願番号	特願2004-522616 (P2004-522616)	(71) 出願人	590000248
(86) (22) 出願日	平成15年7月8日 (2003.7.8)		コーニンクレッカ フィリップス エレク
(85) 翻訳文提出日	平成16年11月30日 (2004.11.30)		トロニクス エヌ ヴィ
(86) 国際出願番号	PCT/1B2003/003014		Koninklijke Philips
(87) 国際公開番号	W02004/009729		Electronics N.V.
(87) 国際公開日	平成16年1月29日 (2004.1.29)		オランダ国 5621 ベーアー アイン
(31) 優先権主張番号	02077998.9		ドーフェン フルーネヴァウツウェッハ
(32) 優先日	平成14年7月23日 (2002.7.23)		1
(33) 優先権主張国	欧州特許庁 (EP)		Groenewoudseweg 1,5
			621 BA Eindhoven, T
			he Netherlands
		(74)代理人	100087789
			弁理士 津軽 進
		(74)代理人	100114753
			弁理士 宮崎 昭彦
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】エレクトロルミネセントディスプレイ及びこのようなディスプレイを有する電子デバイス

(57)【要約】

本発明は、基板に形成された第1のディスプレイピクセル及び第2のディスプレイピクセルを有するエレクトロルミネセントディスプレイに関する。ディスプレイピクセルは、前記基板上に又は前記基板を覆って堆積された第1の電極と、エレクトロルミネセント層と、第2の反射電極とを有する第1の及び第2のディスプレイピクセルは、少なくとも1つの絶縁構造を有する領域によって分離される。前記絶縁構造は、前記第2の反射電極で反射された前記第2のディスプレイピクセルにおける光の出力を抑制するように適応され、前記光は、少なくとも前記第1のディスプレイピクセル及び/又は前記基板から入射する。絶縁構造は、第1のディスプレイピクセルとの間の光のクロストークを低減し、エレクトロルミネセントディスプレイの製造工程に容易に組み込まれることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板に形成された第1のディスプレイピクセル及び第2のディスプレイピクセルを少なくとも有するエレクトロルミネセントディスプレイであって、前記第1の及び第2のディスプレイピクセルは、少なくとも、

- 前記基板上に又は前記基板を覆って堆積された第1の電極と、
- エレクトロルミネセント層と、
- 第2の反射電極と、

を有し、前記第1のディスプレイピクセル及び前記第2のディスプレイピクセルは、少なくとも1つの絶縁構造を有する領域によって分離される、エレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記絶縁構造は、前記第2の反射電極で反射された前記第2のディスプレイピクセルにおける光の出力を抑制するように適応され、前記光は、少なくとも前記第1のディスプレイピクセル及び/又は前記基板から入射する光から生じることを特徴とするエレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項2】

請求項1に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記絶縁構造は、前記第2のディスプレイピクセルの近くに又は前記第2のディスプレイピクセルに沿って少なくとも1つの縁を有する、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項3】

請求項2に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記縁は、前記第2のディスプレイピクセルに対して角度 を有する少なくとも1つの傾斜した側壁を有する、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項4】

請求項3に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記角度 は、(2^{ma×}+2^{min})/2より大きく、ここで、2^{ma×}及び2^{min}は、それぞれ、前記基板と前記絶縁構造との界面における屈折の最大及び最小角である、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項5】

請求項3又は4に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記角度 は、図4-Aに従って所望の視角 5 に依存するように選択される、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項6】

請求項3、4又は5に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記角度は40°より大きい、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項7】

請求項1に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記絶縁構造は、2 .0以上の屈折率を持つ材料で作られる、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項8】

請求項7に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記絶縁構造は、Ti0,又はSnO,を有する、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項9】

請求項3に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記絶縁構造は、前記傾斜した側壁の粗い表面を有する、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項10】

請求項3に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記絶縁構造は湾曲 した側壁を有する、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項11】

請求項1又は2に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記絶縁構造 は吸光粒子を有する、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項12】

50

40

10

20

請求項3に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記絶縁構造は、前記傾斜した側壁の下に適切に堆積された吸光グリッドを有する、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項13】

請求項1又は2に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記絶縁構造は、前記第2の反射電極を部分的に置換する吸光材料を有する、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項14】

請求項1に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記絶縁構造は、請求項1乃至13の何れかの組合せに従って適応される、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項15】

請求項1乃至14の何れか1項に記載のエレクトロルミネセントディスプレイを有する電子デバイス。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0 0 0 1]

本発明は、基板に形成された第1のディスプレイピクセル及び第2のディスプレイピクセルを少なくとも有するエレクトロルミネセントディスプレイであって、前記第1の及び第2のディスプレイピクセルは、少なくとも、

- 前記基板上に又は前記基板を覆って堆積された第1の電極と、
- エレクトロルミネセント層と、
- 第2の反射電極と、

を有し、前記第1のディスプレイピクセル及び前記第2のディスプレイピクセルは、少なくとも1つの絶縁構造を有する領域によって分離される、エレクトロルミネセントディスプレイに関する。本発明は、更に、このようなエレクトロルミネセントディスプレイを有する電子デバイスに関する。

【背景技術】

[0002]

米国特許第5,989,785号は、2つの電極間に挟まれたルミネセント領域を有する基板上に形成されたディスプレイピクセルを有するエレクトロルミネセントデバイスを開示する。ルミネセント領域の光出力は、他のルミネセント領域の光出力によって影響されうる(即ち光のクロストーク)。ルミネセント領域間の光のクロストークは、誘電体膜によってルミネセント領域を絶縁することによって最小化される。薄膜の屈折率は、ルミネセント領域から入射する光を同じルミネセント領域に全反射して戻すように選択される

[0003]

しかし、多くの例において、従来技術のエレクトロルミネセントディスプレイのディスプレイピクセル間の光のクロストークは、依然として明らかである。光のクロストークは、最終的には、エレクトロルミネセントディスプレイ上でゴーストイメージの存在をもたらしうる、即ち、個々のディスプレイピクセルが、ディスプレイ制御手段によって活性化されていないのに「オン」であるように見える。更に、ディスプレイピクセルの構造を適応させることによってクロストークを最小化する試みは、多くの追加の製造ステップをもたらした。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

本発明の1つの目的は、隣接したピクセルから放射される光及び/又はディスプレイの外部からの周辺光に起因するディスプレイピクセル間の光のクロストークを大幅に低減するエレクトロルミネセントディスプレイを提供することである。

20

10

30

【課題を解決するための手段】

[0 0 0 5]

この目的は、前記絶縁構造が、前記第2の反射電極で反射された前記第2のディスプレイピクセルにおける光の出力を抑制するように適応され、前記光は、少なくとも前記第1のディスプレイピクセル及び/又は前記基板から入射することを特徴とするエレクトロルミネセントディスプレイを提供することによって達成される。

[0006]

この絶縁構造は、前記第2の反射電極における反射の結果としてのディスプレイピクセル間の光のクロストークを抑制、低減又は解消しさえし、これにより、エレクトロルミネセントディスプレイ上のゴーストイメージの可能性を低下させる。

[0007]

本発明の好適な実施例において、前記絶縁構造は、前記第2のディスプレイピクセルの近くに又は前記第2のディスプレイピクセルに沿って少なくとも1つの縁を有する。このような縁は、例えば、絶縁層に形成された孔へのディスプレイピクセルの収容によって作製されることができる。この実施例は、このような絶縁構造の作製が、前記エレクトロルミネセントディスプレイの製造工程に追加のステップをもたらさないという利点を有する。絶縁構造は、ディスプレイピクセルに対して角度を有する、前記ディスプレイピクセルに対して角度を有する、前記ディスプレイピクセルのうちの少なくとも1つに向けて傾斜している側壁を示してもよい。傾斜した側壁と基板との角度を慎重に選択することにより、第2の電極を介したディスプレイピクセル間の光のクロストークは、所望の視角に応じて、効果的に抑制されることができる。好適な実施例においては、角度 は40°よりも大きい。なぜならこの場合、光のクロストークは、全視角について実質的に抑制されるからである。

[0008]

本発明の好適な実施例において、絶縁構造は、少なくとも部分的に、高い屈折率を有する材料から作られる。絶縁構造は、好適にはTiO₂又はSnO₂から作られる。より高い屈折率を有するこのような誘電体絶縁層によって従来型の誘電層を置換することは、ディスプレイピクセル間の光のクロストークが抑制されると同時に、このようなエレクトロルミネセントデバイスに追加の製造ステップをもたらさない。

[0009]

本発明の好適な実施例において、絶縁構造の傾斜した側壁は、粗い表面又は湾曲面を有する。このような構造は、容易に得られることができ、且つ、エレクトロルミネセントディスプレイのディスプレイピクセル間の光のクロストークを低減することの効果的な方法を提供する。

[0010]

絶縁構造の側壁の角度、材料又は表面を適応させること以外には、ディスプレイピクセル間の光のクロストークを防止するために、吸光手段も用いられることができる。本発明の好適な実施例において、絶縁構造は吸光粒子を有する。更に、吸収グリッド(例えば黒いマトリクス)が、絶縁層の傾斜側壁の下に堆積されることができる。また、第2の電極が部分的に除去されて、吸光材料によって置換されることができる。吸光材料を有する実施例は、製造に関して単純であり、エレクトロルミネセントディスプレイのディスプレイピクセル間の光のクロストークの効果的な抑制を提供する。

[0011]

米国特許第6,901,195号は、エレクトロルミネセントディスプレイの種々のデバイス間の光のクロストークを低減するためのリフレクタを有するエレクトロルミネセントディスプレイを開示する。このようなエレクトロルミネセントディスプレイと比較して、追加のプロセスステップ及び部品を必要とする。

[0012]

言うまでもなく、本発明の前述の実施例又は前述の実施例の側面が組み合わせられることができる。

10

20

30

40

20

30

40

50

【発明を実施するための最良の形態】

[0013]

本発明の実施例が、添付の図面を参照してより詳細に説明される。

[0014]

図1は、従来型のアクティブマトリクスルミネセントディスプレイの断面の一部である(一定比率ではない)。このアクティブマトリクスディスプレイは、第1の電極2、絶縁層3、有機発光層4及び第2の電極5を持つ基板1を有する。この構成において、エレクトロルミネセントディスプレイは、行及び列に配列される種々のディスプレイピクセル6、7を示す。エレクトロルミネセントディスプレイ及び/又はディスプレイピクセルは、金属層(例えばキャパシタを提供するため)、他の絶縁層(例えばクロスオーバーを規定するため)及び半電導性層(例えば薄膜トランジスタを提供するため)等の追加の幾つかの層を有してもよい。

[0015]

基板1は、好適にはガラス又はプラスチック等の透明材料でできている。基板の厚さは 、 例 え ば 7 0 0 μ m で あ る 。 透 明 基 板 1 は 、 少 な く と も デ ィ ス プ レ イ ピ ク セ ル 6 、 7 が 収 容されるべき部位においては第1の電極2によってカバーされる。第1の電極2は、スパ ッタリング等の堆積プロセスによって基板上に形成される。これらの第1の電極2は、ル ミネセント層4において生成される光に関して好適には透明である。一般的に、これらの 第 1 の電極 2 はインジウムスズ酸化物(ITO)から作られるが、異なった伝導性透明材 料、 例えば伝導ポリマー(ポリアニリン(PANI)又はポリ-3,4-エチレンジオキ シ チ オ フ ェ ン (P E D O T)) も 利 用 可 能 で あ る 。 エ レ ク ト ロ ル ミ ネ セ ン ト デ ィ ス プ レ イ の製造の間、(誘電体)絶縁層3が、第1の電極2の上に堆積され、続いて、ディスプレ イピクセル6及び7が形成されるべき部位においては除去される。この例では、誘電体絶 縁層 3 は、 S i N でできており、 0 . 5 μ m の厚さを有する。実際、絶縁層 3 は、これら の ディスプレイピクセルの方向へ傾斜している側壁 8 、 9 を示す当該絶縁層における孔の 形成によって、ディスプレイピクセル6及び7を分離する。ディスプレイピクセル6、7 の幅は、例えば 5 0 μmであり、これらディスプレイピクセルは、 3 0 μmの距離に亘る 領域によって分離され、この領域のうち、傾斜側壁8、9がそれぞれ5μmを占める。絶 縁層3は、第1の電極2との電気接触が確立されることができれば、傾斜側壁8の隣の第 1の電極2の端に沿って延在してもよいことに注意されたい。従って、この場合、絶縁層 又は構造3の幅は、ディスプレイピクセル6と7との分離領域の幅より大きい。第1の電 極 2 又は絶縁層 3 は、エレクトロルミネセント層 4 又はエレクトロルミネセント材料(例 えばポリ・p・フェニレン(PPV)等の特定の有機材料又はその誘導体)を有する層に よってカバーされる。エレクトロルミネセント層4は、真空蒸着、化学蒸着、又は、スピ ン コ ー テ ィ ン グ 、 デ ィ ッ プ コ ー テ ィ ン グ 若 し く は イ ン ク ジ ェ ッ ト プ リ ン テ ィ ン グ 等 の 液 体 を用いる技術を用いて堆積することができる。エレクトロルミネセント層4は、少なくと も ディ ス プ レ イ ピ ク セ ル 6 、 7 が 形 成 さ れ る べ き 部 位 に お い て 第 2 の 電 極 5 に よ っ て カ バ ーされる。第2の電極は、金属であり、高度に反射性である。

[0016]

図1は、アクティブマトリクスモノクロエレクトロルミネセントディスプレイの断面であるが、本発明及びその利点は、パッシブマトリクスエレクトロルミネセントディスプレイ、セグメントディスプレイ及びカラーディスプレイに同等に適用可能であることに注意されたい。パッシブマトリクスディスプレイにおいては、ディスプレイピクセルは、通常フォトレジスト層又は構造によって分離される。下記において、本発明の実施例は、図1に示されたようなモノクロアクティブマトリクスディスプレイに関して詳細に説明される

[0017]

図 1 に示されるエレクトロルミネセントディスプレイを動作する際に、ディスプレイ制御手段(図示せず)によって電圧が種々のディスプレイピクセル 6 、 7 に印加されることができる。電圧が電極 2 、 5 に印加されなければ、光はルミネセント層 4 では生成されず

、ピクセルは「オフ」であり、これは図1のピクセル7について当てはまる。電圧がルミネセント層4に印加されると、光がこの層4において生成される、即ち、ピクセルは「オン」であり、これはピクセル6について当てはまる。この光は透明な第1の電極2及び透明基板1を通じてディスプレイピクセル6から大気中に出て、結果として、光線10によって示されるように、ディスプレイピクセル6の直接像が得られる。

[0018]

ディスプレイピクセル 6 で生成される光は、ランバート的に(Lambertianally)放出さ れる、即ち、発光は各方向に等しく分散される。従って、一部の光は、光線11によって 示されるように基板1を横断する。これらの光線11は、基板・空気界面で、内部反射さ れ(TIR)、続いて、隣接したディスプレイピクセル7に通じる(即ちクロストーク) 。図1に示されるように、光線11~は、これらの光線11~に対して鏡として動作する 第 2 の 反 射 電 極 5 で 反 射 さ れ る 。 次 に 反 射 光 線 1 1 は 、 第 2 の 反 射 電 極 5 の 傾 き の た め 光 線11~~としてディスプレイピクセル7を出て、結果としてディスプレイピクセル7の 画像を生じさせる。第2の電極5の傾きは、ディスプレイピクセル6、7を収容するため の絶縁層3の孔の傾斜側壁8、9による。このように、ディスプレイピクセル7が「オフ 」であるのに、「オン」のピクセルで発生してエレクトロルミネセントディスプレイ内で 反射した光のクロストークのため、このピクセル7の画像が存在する。この画像は、以下 ではゴーストと呼ばれる。このようなゴーストイメージは、エレクトロルミネセントディ スプレイの外部で生じて(即ち周辺光)、第2の電極5によって反射される光からも生じ うる。ディスプレイピクセル6、7間の光のクロストークは、視角に依存する低減された コントラストを生じ、また、種々のカラー(RGB)ディスプレイピクセルからの光の混 合のためにカラーディスプレイの変色が生じうる。

[0019]

図 2 は、エレクトロルミネセントディスプレイが、第 2 の電極 5 の光の反射に起因するディスプレイピクセル 6 、 7 間の光のクロストークを抑制するように適応された絶縁構造を有する、本発明の種々の実施例を示す。言うまでもなく、ディスプレイピクセルは、図1 に示されているように互いと隣接していなければならないわけではない。光 1 1 は、更に遠くにある、即ち第 2 のディスプレイピクセル 7 に隣接していない、1 つ又は複数のディスプレイピクセルから、上記光に加えて又は単独で生じうる。

[0020]

図2-Aは、絶縁層3の傾斜側壁8が、該傾斜側壁8によって基板1の表面に対して形成される角度 に関して適切に成形されている、好適な実施例を示す。以下に説明されるように、実際の状況では、40°を超える角度 は、全視角において、ディスプレイピクセル7からのゴーストイメージを生じさせる光線11'の第2の電極5からの所望されない反射を実質的に解消又は低減することが分かっている。この実施例は、更に詳細に説明される。

[0021]

図 2 - B は、絶縁層 3 が十分に高い屈折率を有する本発明の好適な実施例を示す。例えば、この誘電層のためにTi〇 $_2$ (n=2.5)又は S n O $_2$ (n=2) が用いられてもよい。高い屈折率は、基板 1 と絶縁層 3 との界面における増加された屈折を生じさせ、これにより、ディスプレイピクセル 6 、 7 間の光のクロストークを効果的に抑制する。

[0022]

図2 - Cは、絶縁層3の傾斜側壁8の表面12が粗くなった本発明の好適な実施例を示す。このような粗面化は、反応性イオンエッチング(RIE)によって容易に得ることができる。代替的に、粗い表面12は、幅が減少する種々の薄い絶縁層を基板1と平行に堆積させ、ステップ状の絶縁層3を得ることによって得られることができる。このような方法のRIEに勝る利点は、絶縁層3におけるピンホールの回避である。傾斜側壁8の粗い表面12の効果は、基板-空気界面からのTIR光11'が第2の電極5によって反射される代わりに拡散されるということであり、結果として、ディスプレイピクセル7のゴーストイメージの光量11',のかなりの減少が得られる。

20

30

40

20

30

40

50

[0 0 2 3]

図 2 - D は、絶縁層 3 の側壁の表面 1 3 が適切に凸状に湾曲させられ、ディスプレイピクセル 7 への光のクロストークが防止される、本発明の好適な実施例を示す。側壁 1 3 の湾曲は、絶縁層 3 の等方性エッチングによって得られることができる。

[0024]

図2 - A ~ 2 - Dにおいて、絶縁構造は、絶縁層3 (の一部)の形状又は材料に調整を加えることにより実現される。これらの調整は、エレクトロルミネセントディスプレイの製造工程において非常に容易に実現されることができる。なぜなら、追加のプロセスステップがほとんど又は全く必要とされないからである。これらの絶縁構造は、他のディスプレイピクセル6からの光又は周辺光によるディスプレイピクセル7のゴーストイメージの出現を抑制する効果的な手法を提供する。ディスプレイピクセル6、7のコントラストは最適であり、カラーディスプレイの変色は解消される。

[0025]

種々のディスプレイピクセル 6、 7 間のクロストーク又は周辺光の影響の効果的な消去に対する第 2 のアプローチは、吸光材料の適用に関する。この方法の種々の実施例は、図 2 ・ E ~ 2 ・ G に示される。

[0026]

図2-Eは、絶縁層3が炭素粒子等の吸光粒子を有する本発明の好適な実施例を示す。吸光粒子は、TIR光線11'が、第2の電極5における反射の前又は後にこれら粒子によって吸収され、この結果、実質的に光11''が絶縁層3を出ないので、効果的なクロストーク防止手段を提供する。

[0027]

図2 - Fは、吸収グリッド14(即ち黒いマトリクス)が、絶縁層3の傾斜側壁8の下に適用された、本発明の好適な実施例を示す。TIR光線11 'は、黒いマトリクス14によって、光線11''として絶縁層3に入る又は絶縁層3から出ることを防止されるので、ディスプレイピクセル6、7間のクロストークは、抑制され又は最適には解消される

[0028]

最後に、図2-Gは、第2の反射電極5が、絶縁層3の傾斜側壁の上で部分的に除去された、本発明の好適な実施例を示す。言うまでもなく、ディスプレイピクセル6、7に対する電圧の印加は依然として可能であるべきである。好適には、絶縁層のむきだしの部分は、吸収材料15によってカバーされる。本実施例において、鏡として動作する第2の電極5の影響はかなり低減され、この結果、ディスプレイピクセル6、7間のクロストークは低減される。

[0029]

図 3 は、図 2 - A を参照する 3 つの場合 A ~ C を示し、ここで、絶縁層 3 の傾斜側壁 8 の角度 が変化される。 $_2$ は、基板 1 と絶縁層 3 との界面における T I R 光線 1 1 $_7$ の 屈折角である。角 $_5$ は、基板 1 の垂線に対する視角を示す。 A では、 0 < $_2$ / 2 且つ $_5$ > 0 である場合が示され、 B では、 $_2$ / 2 < $_5$ く 0 である場合が示され、 C では、 > $_2$ で光出力が存在しない場合が示される。

[0 0 3 0]

20

[0031]

図2 - Aの実施例の他の分析は、図4 - A及び4 - Bに示されるグラフを得る。図4 - Aは、ディスプレイからゴーストイメージが特定の視角 5 で生じる角度 の範囲 R を示す。絶縁層3の傾斜壁についての40°を超える角度 は、第2の電極で非所望の反射を回避して、いかなる視角 5 でもゴーストイメージが生成されないようにするのに十分である。図4 - Bは、グラフ(A)、(B)及び(C)が図3に示されるA~Cのケースに対応する、この結果の代替表現を提供する。

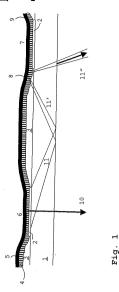
[0032]

本発明を教示するために、ディスプレイ装置の好適な実施例及びこのようなディスプレイ装置を有する電子デバイスが上記で説明された。当業者には、本発明の他の代替例及び 透過の実施例が、本発明の真の精神から逸脱することなく考えられ、実施されることがで きることは明らかであり、本発明の範囲は、特許請求の範囲によってのみ限定される。

【図面の簡単な説明】

- [0 0 3 3]
- 【 図 1 】 従 来 型 の ア ク テ ィ ブ マ ト リ ク ス エ レ ク ト ロ ル ミ ネ セ ン ト デ ィ ス プ レ イ の 断 面 で あ る 。
- 【図2-A】本発明の実施例を示す。
- 【図2 B】本発明の実施例を示す。
- 【図2-C】本発明の実施例を示す。
- 【図2 D】本発明の実施例を示す。
- 【図2 E】本発明の実施例を示す。
- 【図2-F】本発明の実施例を示す。
- 【図2-G】本発明の実施例を示す。
- 【図3】図2-Aに示される本発明の実施例を示す。
- 【図4-A】図2-Aに示される本発明の実施例について実行される計算の結果を示す。
- 【図4-B】図2-Aに示される本発明の実施例について実行される計算の結果を示す。







3 1

Fig. 2A



3 ______13

Fig. 2C

Fig. 2D





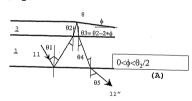


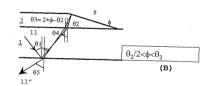
Fig. 2E

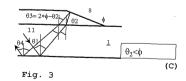
Fig. 2F

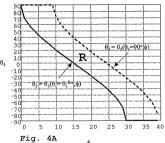
Fig. 2G

【図3】









50 45 40 40 35 30 (C) (B) 10 θ₁ isin -42° (A) 40 50 60 70 80 90 Fig. 4B

【国際調査報告】

			,
	INTERNATIONAL SEARCH REPORT		PCT/IB 03/03014
A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER C09K11/06 H01L51/30 H05B33/0	08	
	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	SEARCHED		
Minimum di IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classificati CO9K H01L H05B	on symbols)	
	llon searchad other than minimum documentation to the extent that s		
EPO-In	ata base consulted during the international search (name of data ba ternal	se and, where practica	l, search terms used)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 989 785 A (INOGUCHI KAZUHIRO 23 November 1999 (1999-11-23) cited in the application figures 1-6 example 1) ET AL)	1-15
X	US 5 703 436 A (FORREST STEPHEN F 30 December 1997 (1997-12-30) figures 1A-C figures 2A-C claims 1-29	R ET AL)	1-15
X	WO 00 70690 A (STURT CLIFFORD MAR TAKEO (GB); SEIKO EPSON CORP (JP) 23 November 2000 (2000-11-23) the whole document	RK ;KAWASE	1-15
		-/	
X Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family	members are listed in annex.
° Special ca	legories of cited documents :	T later document mit	hished after the international filing date
consid 'E' earlier o	nt defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance locument but published on or after the international	or priority date an cited to understan invention	d not in conflict with the application but d the principle or theory underlying the
filing d	nt which may throw doubts on priority claim(s) or	cannot be conside	red novel or cannot be considered to re step when the document is taken alone
citation	i or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be conside document is comb	Jar relevance; the claimed invention ered to involve an inventive step when the bined with one or more other such docu- abation being obvious to a person skilled
P docums laterth	nt published prior to the international filing date but an the priority date claimed	in the ast.	of the same patent family
Date of the a	actual completion of the International search	Date of mailing of	the international search report
	5 October 2003	24/10/2	003
Name and n	alling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5816 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Authorized officer	
POT NO.	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Saldaml 	î, S

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/IB 03/03014

C (Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	PCT/IB 03/03014
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	appropriate, of the towards persongers	rigievant to distrib No.
X	US 5 034 192 A (KITTLESEN GREGG P ET AL) 23 July 1991 (1991-07-23) figures 2,4A,6,7	1-15

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

INTERNA	TIONAL SEARCH	REPORT	PCT/IB	03/03014
Patent document cited in search report	Publication date	Patent fa member		Publication date
US 5989785	A 23-11-199	9 JP 8227	793 A	03-09-1996
	A 30-12-199	AT 246 AU 2278 CA 2248 CN 1218 DE 69723 EP 0888 ES 2157 FR 2748 IT MI97 JP 2000507 WO 9733 US 2001000 US 6264 AT 2206 CN 1293 CN 1291 CN 1291 CN 1293 CN 1291 CN 1293 CN 1291 FF 2003507 FF 2732 FF 27	296 A1 243 A1 243 A1 2005 A1 805 B1 246 T B2 376 A A A A A A A 256 A A A A A A A 368 A A A A A 368 A A A A 368 A A A A 376 A A A A A 376 A A A A A 376 A A A 377	13-01-1998 15-08-2003 22-09-1997 12-09-1997 28-04-1999 11-09-2003 23-12-1998 16-08-2001 12-09-1997 07-09-1998 06-06-2000 12-09-1997 24-10-2002 15-03-2001 24-07-2001 15-07-2002 23-04-1998 10-07-1996 30-12-1997 27-06-1996 02-05-2001 11-04-2001 14-01-1998 11-12-1997 08-08-2002 06-03-2003 25-07-2001 26-11-1997 01-08-1998 17-07-1997 14-06-1996 04-10-1996 04-10-1996 04-10-1996 04-10-1996 04-10-1996 04-10-1996 04-10-1996 04-10-1997 13-06-1996 07-04-1998 05-10-2001 11-08-1997 27-10-1997 10-12-2000 27-06-1998 26-05-1998 26-05-1998 26-05-1998 26-05-1998 29-02-2000 29-11-2000 05-12-2000 13-06-2001 23-11-2000 07-01-2003
US 5034192 /	23-07-199	L US 4895	B17 B1 	29-10-2002 23-01-1990 26-01-1988

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/IB 03/03014

Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5034192 A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AU	605057 B2	03-01-1991
		ΑU	4787990 A	10-05-1990
		ΑЦ	589920 B2	26-10-1989
		AU	5030685 A	05-06-1986
		CA	1243419 AI	18-10-1988
		CA	1260159 A2	26-09-1989
		DE	3588098 D1	15-05-1996
		ΕP	0185941 A2	02-07-1986
		JP	2073456 C	25-07-1996
		JP	7095052 B	11-10-1995
		JP	62011159 A	20-01-1987
		US	4936956 A	26-06-1990
		US	4929313 A	29-05-1990
		US	4717673 A	05-01-1988

Form PCT/ISA/218 (patent family annex) (July 1992)

フロントページの続き

(81)指定国 AP(GH,GM,KE,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IT,LU,MC,NL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

(74)代理人 100122769

弁理士 笛田 秀仙

(72)発明者 ジラルド アンドレア

オランダ国 5656 アーアー アインドーフェン プロフ ホルストラーン 6

(72)発明者 ジョンソン マーク ティー

オランダ国 5656 アーアー アインドーフェン プロフ ホルストラーン 6

F ターム(参考) 3K007 AB17 BA06 DB03